激光写光电子学进展

大视场大数值孔径显微物镜光学设计

黄木旺1,2,刘旭1*,林法官2

¹浙江大学光电科学与工程学院,浙江 杭州 310027; ²福建福特科光电股份有限公司,福建 福州 350100

摘要 在纳米激光直写加工系统中,显微物镜是其中的关键部件,行业发展的趋势是在大数值孔径(NA)下具有更大的物方视场,并且能适应双光子聚合(Two-photon polymerization, TPP)胶折射率的变化。对比当前TPP效应研究所用显微物镜的指标,挖掘了物方视场、NA和镜片数的关系,并提出物镜的合成敏感度指标(Synthetic sensitivity index, I_{ss})。结合 I_{ss}设计了一款波段为500~800 nm、NA大于1.3、物方视场为1.0 mm 的显微物镜。该物镜的设计结果为,调制传递函数曲线接近衍射极限,波像差均方根小于0.07λ,以内调焦方式来适应TPP胶折射率的变化。公差分析表明该设计结果具有可行性。

关键词 光学设计;大视场;大数值孔径;平场复消色差显微物镜;激光直写;微纳加工 中图分类号 O439 文献标志码 A D

DOI: 10.3788/LOP220458

Design of Large Field of View and High Numerical Aperture Microscope Objective

Huang Muwang^{1,2}, Liu Xu^{1*}, Lin Faguan²

¹College of Optical Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, Zhejiang, China; ²Foctek Photonics, Inc., Fuzhou 350100, Fujian, China

Abstract The microscope objective is the key component of the nano-laser direct writing processing system, and the development trend in industry involves a large object-side field of view under a large numerical aperture (*NA*) and adapting to the change of the refractive index of the photoresist for two-photon polymerization (TPP). This paper compares the indicators of the microscope objective used in current TPP effect research, excavates the relationship between the object-side field of view, *NA*, and number of lenses, and proposes the objective synthetic sensitivity index (*I*_{ss}). Combined with the *I*_{ss}, a microscope objective with a wavelength range of 500–800 nm, *NA*>1.3, and an object-side field of view of 1.0 mm is designed. The resultant design of the objective lens involves a modulation transfer function curve close to the diffraction limit and a root mean square of wave aberration less than 0.07 λ and uses the internal focusing method to adapt to the change of photoresist refraction for TPP. Tolerance analysis demonstrates that the design results are feasible.

Key words optical design; large field of view; large numerical aperture; flat-field achromatic microscope objective; laser writing; micro-nanofabrication

1引言

飞秒(10⁻¹⁵ s)脉冲激光双光子微纳加工技术^[15]是 利用双光子聚合(Two-photon polymerization, TPP) 效应实现的具有纳米级三维(3D)分辨率、非接触式增 材制造技术,俗称微纳3D打印技术。TPP材料或 TPP胶是在普通光敏固化材料中添加少量的高灵敏 度双光子引发剂得到的。TPP效应,即利用TPP材料 分子一次吸收两个光子,各光子能量约为分子基态和 激发态能量差的一半,从而使液态材料发生聚合而固 化,而激发光需要足够高的光子密度^[6]。在研究 TPP 效应时,国内外科研机构和高校使用两种方式:1)大 多数采用20×、60×、100×等商用油浸显微物镜,少 数自研专用显微物镜,再配合其他部件搭建系统; 2)购买商用的设备。其中,大数值孔径(*NA*)显微物 镜可实现高度聚焦光线,是此系统的关键器件之一。

本文对国内外研究 TPP 效应时采用的显微物镜 指标进行对比;依据所需要指标,提出显微物镜的设计 难度系数(D),以此预测物镜所需的镜片数,并提出衡 量物镜敏感度的合成敏感度指标(Synthetic sensitivity

收稿日期: 2022-01-05; 修回日期: 2022-01-14; 录用日期: 2022-01-20; 网络首发日期: 2022-01-30 通信作者: ^{*}liuxu@zju.edu.cn

研究论文

index, *I*_s);选择合适的结构和材料,利用成像设计软件 CODE V并结合 *I*_s指标,进行像质和敏感度优化;最终 得到了一款无限远校正类型、波段在 500~800 nm、物 方视场直径达1.0 mm、*NA* 为1.316、内对焦式大视场 大数值孔径的平场复消色差显微物镜,并对其进行了 公差分析。

2 设计过程

2.1 物镜规格对比

国际先进TPP设备厂家^[7](如德国Nanoscribe公司)和自行搭建TPP系统^[8]的物镜参数汇总见表1,长度单位均默认为mm。

表1 物镜规格对照 Table 1 Objective specification comparison

Deremeter	Noncoribo		Olumpua	75166	Our
1 di dilletei	INalio	scribe	Orympus	ZEISS	project
NA	1.4	0.8	1.3	1.3	1.3
Mag.	63 imes	$25 \times$	$100 \times$	$100 \times$	$100 \times$
W.D.	0.36	0.38	0.2	0.2	0.5
F.D.	0.28	0.7	0.265	0.23	1.00
C.G.			0.17	0.17	—
nd	1.515	1.515	1.515	1.515	1.522
vd	—	—	40.8	41.58	34.1

表1中,nd、vd是指浸润材料的折射率和阿贝数, Mag.表示放大倍率,W.D.表示工作距离,F.D.表示 物方视场直径,C.G.表示盖玻片厚度,盖玻片用肖特 D263。浸润材料(TPP胶或浸油)和盖玻片均为物镜 的物方工作介质。德国Nanoscribe公司采用蔡司的通 用物镜,未用100×的物镜。从理论和使用上,发现在 TPP效应研究中大NA、大倍率物镜要表现出应有的 性能,则要求物镜在设计时严格匹配浸润材料的光学 参数(折射率和阿贝数)。当调整TPP胶成分时,主要 引起其折射率的较小变化,系统应具有调节功能以避 免性能下降,比如物镜使用内对焦方式。

2.2 主要设计规格

物镜规格见表2。

在满足平场和复消色差前提下,全视场波像差均

衣4 初現以月死俗

Table 2	Objective	design	spece
---------	-----------	--------	-------

Parameter	Spec	
Spectral range /nm	532-780	
Objective field number	1.0	
Numerical aperture	≥1.3	
Working distance	≥0.5	
Total length	<250	
RMS of wavefront error $/\lambda$	0.09	
Distortion / %	< 0.5	

第 60 卷 第 5 期/2023 年 3 月/激光与光电子学进展

方根(Root mean square, RMS)应接近 Marechal 判据^[9],即 $\lambda/14$ 。在100倍率和NA为1.3条件下,物方视场直径由常规的不到0.3 mm提高至1.0 mm,工作距离也加大到0.5 mm。在这种超常规的物镜要求下,为预测作为重要设计参数之一的镜片数量,对物镜规格和镜片数量关系进行了分析。从文献[10]中选取了相同像方视场直径下4种倍率的物镜进行比较,相关参数见表3。

表3 各种倍率显微物镜规格对照 Table 3 Comparison of various microscope objectives

	-			
Magnification	NA	Number of lens	$NA \bullet y$	$(NA)^2 \cdot y$
$10 \times$	0.22	4	0.176	0.039
$20 \times$	0.49	5	0.196	0.096
$47.5 \times$	0.91	7	0.153	0.139
98 imes	1.28	7	0.104	0.134

表3中,y为物方视场半径,其数值等于像方视场 半径8mm除以倍率。因物镜的浸油对提高NA有重 要作用,也计为一枚镜片。一般用拉赫不变量J= NA•y来衡量光学系统的设计难度^[11]。从表3的 47.5×和98×的镜片数来看,两者设计难度相差不 大,但J数值相差较多。

考虑到光学系统的通光量与NA值的平方成正比 以及表3的数据,可知用物镜设计难度系数D=(NA)²· y进行衡量更好。D指标数值每增加0.04,镜片数大 约增加1枚。待设计物镜的D值为1.3²×1.0/2= 0.845,数值比常规98×物镜的增加了0.711,为后者 的6.3倍,至少要增加18枚镜片,即镜片总数不低于 25,但内调焦方式等因素会导致镜片数增加。

2.3 物镜敏感度指标

对大NA物镜而言,由误差所造成的实际系统性能衰减比较严重。因此,优化该类系统的敏感度尤为重要。显微镜物镜属于小视场角、大孔径类型系统,其中球差和彗差影响较大。其次,孔径边缘光线的入射角超过30°后容易引起系统敏感^[12]。因此,综合以上三点因素,提出并采用单一数值的合成敏感度指标*I*_{ss}来衡量,以方便分析和优化系统的敏感度:

$$I_{\rm ss} = \sqrt{\sum_{i=1}^{L} \frac{A_i}{30} \left(S_i^2 + T_i^2 \right)} , \qquad (1)$$

式中:A_i为第*i*个表面上的孔径边缘光线的入射角,S_i 为第*i*个表面上的初级球差,T_i为第*i*个表面上的初级 彗差,L为最后一个表面的编号。由以往设计及量产 经验可知:在保证性能和敏感度前提下,NA>0.4系 统,I_{ss}数值应控制在1.6以内;0.15<NA<0.3系统, I_{ss}数值应控制在1.3以内。因此,本物镜方案优化后I_{ss} 应该控制在1.6以内。

2.4 系统初始结构

获取镜头初始结构数据有两种方式:1)利用薄透

研究论文

第 60 卷 第 5 期/2023 年 3 月/激光与光电子学进展

镜初级像差理论进行变量替换后计算得到,比如源自 德国蔡司公司的兰格变量替代法(PWC法)和日本佳 能公司的松居变量替代法(ABC法);2)查阅及使用国 内外的专利、数据手册、本单位以往设计的数据,甚至 拆解类似品逆向所得数据。前者所得结果^[13-19]不一定 合适,不能保证其敏感度低,也一样要借助设计者的理 论水平、经验和直觉,结合实际的加工和装调能力,经 过软件精细调整优化达到规格要求。而后者可借助成 熟的方案,更加直接快捷,本文将使用后种方式。

查阅大量专利和镜头数据手册,发现NA超过1.0 的无限远校正的物镜,大多由部分复杂化双高斯结构, 加上物方端齐明透镜形式构成^[20-21]。选定图1所示的 形式为初始结构,共计20枚镜片,含1枚三胶合镜片。 初始系统的I_{ss}数值较大,为5.356。



图 1 初始系统结构 Fig. 1 Initial system structure

3 设计结果

3.1 结果汇总

借助 CODE V 软件^[22]进行优化,在适当的位置增加镜片来提高性能,在性能评估函数中使用 I_{ss}来降低系统敏感度,并结合加工和装调因素,最终优化得到符合设计要求的物镜,其参数见表4。

表4 设计好的物镜参数 Table 4 Specs of designed objective

Parameter	Spec
Spectral range /nm	532-780
Effective focal length	7.5
Half field of view /($^{\circ}$)	4.2
Objective field number	1.0
Numerical aperture	1.316
Working distance	0.5
Total length	231.1
RMS of wavefront error $/\lambda$	0.05
Distortion / %	0.21
Number lens element	27

从表4可见,设计后的各项指标,都达到了规格, 且镜片数量与原来预测的接近,该物镜结构如图2 所示。

当 TPP 胶 折 射 率 分 别 为 1.522、1.520 和 1.527 时, *I*_{ss}数值分别 1.374、1.372 和 1.378,相对初始状态,

敏感度都得到大幅下降。

本系统可在NA=1.3规格下,使用内对焦方案兼容TPP胶的折射率变化(-0.002~+0.005)。内对焦即在其前后透镜组不动,移动其镜组,以此适应物方介质折射率变化。当TPP胶折射率往1.520变化时,内对焦透镜组朝物方移动;当TPP胶折射率往1.527变化时,朝像方移动。图3为光学系统在TPP胶折射率为1.522时的调制传递函数(MTF)曲线,接近衍射极限,在其折射率为1.520和1.527时曲线也基本一致。

3.2 公差分配

对大NA、大视场显微物镜而言,制造中导致系统 性能下降的误差类型有玻璃折射率偏差、元件的加工 公差及装配公差两大类。由于系统对玻璃折射率公差 要求高且难以补偿,已大大超出常规的±3×10⁻⁴标 准。在制造中,先买材料实测F、e、d、C、r及s这6条夫 琅禾费谱线的折射率,再代入实测数据进行微调后才 结束设计工作。

在软件公差分析方面进行如下设置:1)材料的折射 率测量误差为 \pm 5×10⁻⁵~ \pm 1×10⁻⁵,均匀性为 \pm 2× 10⁻⁶~ \pm 5×10⁻⁶;2)镜片加工公差为2~3个光圈,局部 光圈为0.3,中心厚度误差为0.005~0.010 mm,倾斜 误差为20~40″。

通过公差灵敏度分析,系统的装调公差分配见 表5。在公差分配过程中,除了通过调整间隔来补偿 加工和装调误差以外,还对特定镜片进行偏心调整以 便补偿系统的偏心误差^[23-25],通过分析可知,系统中



图 2 设计结果 Fig. 2 Final design result



Item	Value
Airspee	0.005-0.01
Tilt /rad	0.00007-0.00029
Decenter	0.003-0.01

Lens 13 和 Lens 25 适合作为偏心补偿器的特定镜片, 补偿范围计算结果见表 6。

表6 补偿器移动范围 Table 6 Compensator range

1	8
Item	Value
Defocus of image surface	0.001
Lens 13 (X direction)	0.0105
Lens 13 (Y direction)	0.0175
Lens 25 (X direction)	0.0434
Lens 25 (Y direction)	0.0505

在本设计方案未应用 I_{ss}之前,由公差灵敏度分析 得知,个别镜片的偏心装配公差要求小于0.001 mm, 这实现起来很困难。波像差 RMS 公差分析结果如 图 4 所示,在 80% 概率内除了最外视场 F5 稍差些,各 视场波像差 RMS 基本在 0.09λ 以内,说明本设计可得 到满足规格的实物。





4 结 论

研究了显微物镜的物方视场直径、NA值与镜片 数量的关系,得到其设计难度指标D,并提出了物镜的 敏感度指标I_s;在使用CODEV优化的同时,结合I_s指 标降低了公差敏感度。设计得到了一款物方视场直径 1.0 mm、NA=1.316 的平场复消色差物镜。该物 镜的复消色差波段为双光子工作波段500~800 nm, 系统总长度为231.1 mm。各项性能指标表明光学系 统像质接近衍射极限,能满足总体指标要求。为适应 TPP胶折射率的波动,采用内对焦方式。最终的公差 分析结果表明此方案具有可行性。

参考文献

- Kawata S, Sun H B, Tanaka T, et al. Finer features for functional microdevices[J]. Nature, 2001, 412(6848): 697-698.
- [2] 王荣荣,张维彩,金峰,等.双光子聚合制备聚苯胺微 结构[J].中国激光,2021,48(2):0202006.
 Wang R R, Zhang W C, Jin F, et al. Fabrication of polyaniline microstructure via two-photon polymerization [J]. Chinese Journal of Lasers, 2021, 48(2):0202006.
- [3] 杨雪,孙会来,岳端木,等.飞秒激光制备微透镜阵列 的研究进展[J].激光与光电子学进展,2021,58(5): 0500005.

Yang X, Sun H L, Yue D M, et al. Research progress of femtosecond laser fabrication of microlens array[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2021, 58(5): 0500005.

- [4] 王卫京,周新颖,刘文军.利用飞秒激光烧蚀加工金属 掩模板[J].科技信息(科学教研),2007(21):148-150.
 Wang W J, Zhou X Y, Liu W J. Machining metal mask plate by femtosecond laser ablation[J]. Science & Technology Information, 2007(21):148-150.
- [5] 巫殷忠,黄燕华,尹强,等.高厚度薄膜-泡沫平面调制 靶的飞秒激光微加工[J].强激光与粒子束,2011,23(3): 685-688.

Wu Y Z, Huang Y H, Yin Q, et al. Thick modulated planar film-foam target fabricated by femtosecond laser micromachining[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2011, 23(3): 685-688.

- [6] 宋晓艳,邢金峰.双光子聚合 3D 打印[J]. 化工学报, 2015, 66(9): 3324-3332.
 Song X Y, Xing J F. 3D printing technology based on two-photon polymerization[J]. CIESC Journal, 2015, 66 (9): 3324-3332.
- [7] Gissibl T, Thiele S, Herkommer A, et al. Two-photon direct laser writing of ultracompact multi-lens objectives
 [J]. Nature Photonics, 2016, 10(8): 554-560.
- [8] Chung T T, Tu Y T, Hsueh Y H, et al. Micro-lens array fabrication by two photon polymerization technology
 [J]. International Journal of Automation and Smart Technology, 2013, 3(2): 131-135.
- [9] 王之江.实用光学技术手册[M].北京:机械工业出版 社,2007.

第 60 卷 第 5 期/2023 年 3 月/激光与光电子学进展

研究论文

Wang Z J. Handbook of practical optical technology[M]. Beijing: China Machine Press, 2007.

- [10] Laikin M. Lens design[M]. 3rd ed. New York: Dekker, 2001.
- [11] 郁道银,谈恒英.工程光学[M].北京:机械工业出版 社,1999.

Yu D Y, Tan H Y. Engineering optics[M]. Beijing: China Machine Press, 1999.

- [12] 草川徹.レンズ光学一理論と実用プログラム[M].東京:東海大学出版会,1988.
 Toru K. Lens Optics-theory and practical program[M].
 Tokyo: Tokai University Press, 1988.
- [13] 李林.现代光学设计方法[M].北京:北京理工大学出版 社,2009.
 Li L. Modern optical design method[M]. Beijing: Beijing
- Institute of Technology Press, 2009. [14] 周恩源,刘丽辉,刘岩,等.近红外大数值孔径平场显 微物镜设计[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(7): 0718006. Zhou E Y, Liu L H, Liu Y, et al. Design of high NA flat-field microscope objective for near infrared[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(7): 0718006.
- [15] 肖倩. 生物显微镜变倍物镜的光学设计[J]. 光学仪器, 2007, 29(2): 78-81.
 Xiao Q. Optical design of biological zoom microscope objective[J]. Optical Instruments, 2007, 29(2): 78-81.
- [16] 刘仲禹,张欣婷,吴倩倩.高分辨率紫外/可见宽波段显 微物镜设计[J].应用光学,2013,34(4):575-578.
 Liu Z Y, Zhang X T, Wu Q Q. High resolution ultraviolet/visible wide band microscope objective[J]. Journal of Applied Optics, 2013, 34(4):575-578.
- [17] 毛文炜.现代光学镜头设计方法与实例[M].北京:机械 工业出版社,2013.

Mao W W. Modern optical lens design: methods and examples[M]. Beijing: China Machine Press, 2013.

[18] 袁旭沧.光学设计[M].北京:北京理工大学出版社, 1988.

Yuan X C. Optical design[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 1988.

- [19] 近藤文雄.レンズの設計技法[M].東京:光学工業技術 研究組合, 1978.
 Fumio K. Lens design techniques[M]. Tokyo: Optical Industry Technology Research Association, 1978.
- [20] Kurvits J A, Jiang M M, Zia R. Comparative analysis of imaging configurations and objectives for Fourier microscopy[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2015, 32(11): 2082-2092.
- [21] 帕诺夫,安特列耶夫.显微镜的光学设计与计算[M].包 学诚,译.北京:机械工业出版社,1982. Панов В А, Андреев Л Н. Optical design and calculation of microscope[M]. Bao X C, Transl. Beijing: China Machine Press, 1982.
- [22] 郁晓晖.宽光谱大数值孔径平场复消色差物镜设计[D]. 南京:南京理工大学,2018.
 Yu X H. Design of flat-field achromatic objective lens with wide spectrum and large numerical aperture[D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2018.
- [24] 薛金来, 巩岩, 李佃蒙. N.A.0.75平场复消色差显微物 镜光学设计[J]. 中国光学, 2015, 8(6): 957-963.
 Xue J L, Gong Y, Li D M. Optical design of the N. A. 0.75 plan-apochromatic microscope objective[J]. Chinese Optics, 2015, 8(6): 957-963.
- [25] 许伟才.投影光刻物镜的光学设计与像质补偿[D].长春:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,2011.
 Xu W C. Optical design and imaging performance compensation for the lithographic lens[D]. Changchun: Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, 2011.